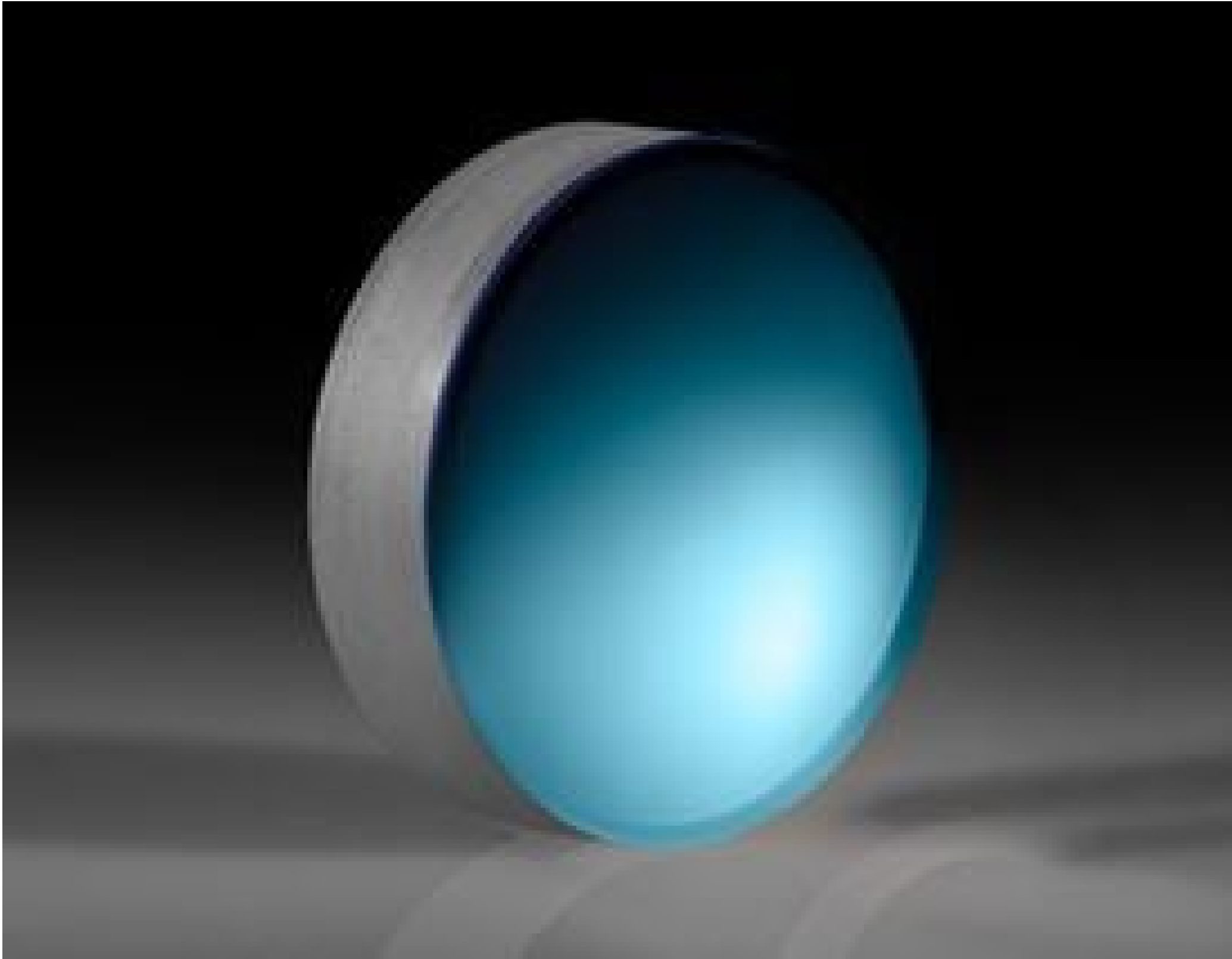


[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Miroir Laser en Silicium non Tralté, 600 - 1000 nm, 25,4 mm de Dia.



Stock **#90-139** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€98^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€98,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Laser Mrror Substrate

Propriétés physiques et mécaniques

Parallélisme (arcmin):

<3

Ouverture Utile (%):

90

Surface Arrière:

Commercial Polish

25.40 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
6.35 ±0.10	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
40-20	Qualité de Surface:
N/A	Spécification du Traitement:
λ/10	Planéité de Surface (P-V):
Uncoated	Traitement:
Optical Grade Silicon	Substrat: □
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Substrat de silicium pour les systèmes de lasers à impulsions ultracourtes exigeants sur le plan thermique
- Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 40-20
- Disponibles en diamètres standard pour la flexibilité du traitement et l'intégration dans les systèmes

Les Substrats de Miroirs Laser en Silicium TECHSPEC® sont des substrats en silicium à haute conductivité thermique conçus pour les applications laser à haute puissance et ultrarapides exigeantes sur le plan thermique. Optimisés pour une distribution efficace de la chaleur dans les configurations optiques difficiles, ces substrats permettent d'atténuer la distorsion du front d'onde induite par la chaleur. Conçus comme une plate-forme prête à être traitée, les Substrats de Miroirs Laser en Silicium TECHSPEC® constituent une base flexible pour des solutions personnalisées de miroirs à large bande ou à faible dispersion. Disponibles en 12,7 mm, 25,4 mm et 50,8 mm de diamètre, ces miroirs offrent une grande souplesse d'intégration dans les systèmes laser les plus divers.